# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-268129

(43)Date of publication of application: 01.11.1990

(51)Int.CI.

C07C 43/23 C07C 41/03 C07C 41/16 C08G 18/32 C08G 18/48 C08G 63/66 C08G 63/66 C08G 64/02 C08G 64/16 C08G 65/38 C08G 67/00

(21)Application number : **01-087900** 

(71)Applicant: SANKO CHEM CO LTD

SEKISUI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

10.04.1989

(72)Inventor: **SAITO TORANOSUKE** 

IKEMOTO KENICHI

KADOMACHI HIRONORI

# (54) 4,4"'-DIHYDROXYQUARTERPHENYL DERIVATIVE AND PRODUCTION THEREOF

(57) Abstract:

NEW MATERIAL:A 4,4"'-dihydroxyquarterphenyl derivative expressed by formula I (R is alkylene; m and n are integer of  $\geq 0$ , provided that m and n are not simultaneously O).

EXAMPLE: A compound expressed by formula II.

USE: A monomer for a chemically and physically excellent organic high polymer compound, e.g. polyester resin, polyurethane resin, polyether resin, polycarbonate resin or liquid crystal resin, having high performance such as high heat resistance, flame-retardant, solvent resistance or weather resistance and further, additive having excellent modification ability to other high polymer compound.

PREPARATION: 4,4"'-Dihydroxyquarterphenyl expressed by formula III is reacted with an alkylene oxide, alkylene carbonate or haloalkanol to provide the compound expressed by formula I.

H

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

## 4,4"'-DIHYDROXYQUARTERPHENYL DERIVATIVE AND PRODUCTION THEREOF

Publication Number: 02-268129 (JP 2268129 A), November 01, 1990

#### **Inventors:**

- SAITO TORANOSUKE
- IKEMOTO KENICHI
- KADOMACHI HIRONORI

### **Applicants**

- SANKO CHEM CO LTD (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)
- SEKISUI CHEM CO LTD (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application Number: 01-087900 (JP 8987900), April 10, 1989

### **International Class (IPC Edition 5):**

- C07C-043/23
- C07C-041/03
- C07C-041/16
- C08G-018/32
- C08G-018/48
- C08G-063/66
- C08G-063/66
- C08G-064/02
- C08G-064/02
   C08G-064/16
- C08G-065/38
- C08G-067/00

### **JAPIO Class:**

- 14.1 (ORGANIC CHEMISTRY--- Organic Compounds)
- 14.2 (ORGANIC CHEMISTRY--- High Polymer Molecular Compounds)

### **JAPIO Keywords:**

- R118 (CHEMISTRY--- Fire Resistant Resins)
- R119 (CHEMISTRY--- Heat Resistant Resins)
- R125 (CHEMISTRY--- Polycarbonate Resins)

#### Abstract:

NEW MATERIAL: A 4,4"-dihydroxyquarterphenyl derivative expressed by formula I (R is alkylene; m and n are integer of >=0, provided that m and n are not simultaneously O).

EXAMPLE: A compound expressed by formula II.

USE: A monomer for a chemically and physically excellent organic high polymer compound, e.g. polyester resin, polyurethane resin, polyether resin, polycarbonate resin or liquid crystal resin, having high performance such as high

heat resistance, flame-retardant, solvent resistance or weather resistance and further, additive having excellent modification ability to other high polymer compound.

PREPARATION: 4,4"-Dihydroxyquarterphenyl expressed by formula III is reacted with an alkylene oxide, alkylene carbonate or haloalkanol to provide the compound expressed by formula I. (From: *Patent Abstracts of Japan*, Section: C, Section No. 798, Vol. 15, No. 31, Pg. 1, January 24, 1991)

### **JAPIO**

© 2001 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 3292629

4,4-Dihydroxyquaterphenyl deriv. - useful for monomers of highly functional macromolecular cpds. Patent Assignee: SANKO KAIHATSU KAGAKU KENKYUSHO; SEKISUI CHEM IND CO LTD

## **Patent Family**

Patent Number	Kind	Date	<b>Application Number</b>	Kind	Date	Week	Type
JP 2268129	A	19901101	JP 8987900	Α	19890410	199050	В
JP 2636042	B2	19970730	JP 8987900	A	19890410	199735	

Priority Applications (Number Kind Date): JP 8987900 A (19890410)

#### **Patent Details**

Patent	Kind	Language Pa	nge Mair	IPC	Filing Notes
JP 2636042	B2	8			Previous Publ. patent JP 2268129

#### Abstract:

JP 2268129 A

A 4,4"'-dihydroxyquaterphenyl deriv. is of formula (I). R = alkylene, each m and n = 0 or an integer of at least 1 and m and n is not 0 simultaneously.

Prepn. is by reaction of 4,4"'-dihydroxyquaterphenyl of formula (II) and an alkylene oxide, alkylene carbonate or haloalkanol to give a cpd. of formula (I).

USE/ADVANTAGE - The invention provides 4,4"'-dihydroxyquaterphenyl derivs. useful as monomers for highly functional organic macromolecular cpds. such as polyester, polyurethane, polyether and liq. crystal resins with heat, weather, solvent and chemical resistance, fire retardancy and durability and as modifiers for macromolecular cpds. and their mfg. method.

In an example, into a mixt. of 67.9g 4,4"'-dihydroxyquaterphenyl, 52.8g ethylene carbonate and 460 g sulpholane at 130-140 deg. C under stirring, is added 0.2 g anhydrous K carbonate powder and, after about 30 mins., further 0.2 g KOH powder, the mixt. is kept for 3 hrs. at the temp. and reacted for 3 hrs. at 160 deg. C., cooled and filtered by suction, the filtered mass is washed with water and methanol and dried for 2 hrs. at 100 deg. C under reduced pressure and 83.4 g of the obtd. crude prod. (crude yield: 98%) is recrystallised from sulpholane to give a cpd. of formula (I), where R = ethyl and each m and n = 1, with a m.pt. of 390 deg. C and a purity of 99.0%.

Dwg.0/0

Derwent World Patents Index © 2001 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 8484711

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平2-268129

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月1日

C 07 C 43/23 41/03 41/16 D 7419-4H

×

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全7頁)

**図発明の名称** 4,4 " ージヒドロキシクオーターフエニル誘導体およびその製造
方法

②特 頭 平1-87900

20出 頭 平1(1989)4月10日

@発 明 者 斉 藤 寅 之 助 大阪府茨木市山手台5丁目17-21

**@発明者池本憲一熊本県荒尾市増永2712-15** 

**20**発 明 者 角 町 博 配 大阪府茨木市大手町 7 - 20

⑪出 願 人 株式会社三光開発科学 大阪府茨木市五日市 1 丁目10番24号

研究所

②出 願 人 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号

四代 理 人 弁理士 山下 穣平

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

4.4~- ジヒドロキシクオーターフェニル財革 体⇒よびその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 一般式(1)

(式中、Rはアルキレン菌を示し、ロタよび n は 0 または 1 以上の整数を示す。ただしmと n が同時に 0 であることはない。)

で表わされる 4.4°- ジヒドロキシクオーターフェニル砂導体。

2. 一般式(I)中、Rが-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-基または
-CH-CH<sub>2</sub>-基であり、m=n=1である請求項1
-CH<sub>5</sub>

記載の 4.4%- リヒドロキシクオーターフェニル語 導体。

3. 式(11)

で表わされる 4,4"- ジヒドロキシクオーターフェニルとアルキレンオキシドを反応させる請求項1 記載のジヒドロキシクオーターフェニル誘導体の製造方法。

**(II)** 

オルキレンオキシドの代りにアルキレンカーポネートを反応させる請求項3記載の製造方法。

5. アルキレンオキシドの代りにハロアルカノ 一ルを反応させる請求項3配載の製造方法。

6. 式(I)

で表わされる 4,4°- ジヒドロキシクオーターフェニルとエチレンカー ポネートまたは(イソ)プロピレンカー ポネートを反応させる請求項 2 配敷のジヒドロキシクオーターフェニル砂導体の製造方法。

### 3.発明の詳細な説明

### ( 産業上の利用分野 )

本発明は 4.4°- ジェドロキシクオーターフェニル 誘導体およびその製造方法に関する。本発明によって提供される化合物は、高性能の有根高分子化合物のモノマーとして、又従来の高分子化合物の添加剤として優れた改質能を有するものとして、極めて注目されるものである。

#### 〔従来の技術〕

世来有根高分子化合物のジオール成分として、マナレングリコール、プロピレングリコール、ターシャングリコール、シクロへ ササンタリコール、シクロへ 類になった。 田環族 ジオール 知 ロール A、ピスフェノール P、ピスフェング P、ピスプロピール M、アングロ P、アングロ P

で扱わされる 4.4°- ジェドロキンクオーターフェニルとアルキレンオキシド、アルキレンカーポネートまたはハロアルカノールを反応させることによる一般式(I)で示される 4.4°- ジェドロキシクオーターフェニル勝導体の製造方法が提供される。特にRが-CH2-Aであり、CH1

m = n = 1 である一般式(I)で表わされる化合物を よびその製造方法が提供される。

本発明の化合物は有极高分子化合物例をばばりエステル樹脂、ポリクレタン樹脂、ポリエーテル樹脂、水リカーボネート樹脂、液晶性樹脂等のモノマーとして使用され高耐熱性、難燃性、耐溶剤性、耐食性その他化学的、物理的性質に優れた樹脂を与え、又その他の樹脂に添加して優れた化学的物理的性質の改良効果を発揮する。

式(1)で示される 4,4- ツヒドロキシクオーター

ーポネート樹脂やポリエーテル樹脂等の構成成分 として使用されている。

[発明が解決しようとする問題点]

近来、上記の如き有根高分子化合物について、 さらに高性能化が要望され、特に耐熱性、耐久性、 耐楽品性等にかいて高度の品質が求められるよう になった。

[問題を解決するための手段及び効果]

本発明者らはこの様な要望に応えるべき程々研究を重ねた結果、本発明に到達した。

ナなわち本発明に従って、一般式(I)

$$H \leftarrow OR \rightarrow_m O \leftarrow O \rightarrow_m H$$
 (1)

(式中、Rはアルキレン基を示し、mおよび n は 0 または 1 以上の整数を示す。ただしmと n が同時に 0 であることはない。〕

で表わされる 4,4" - ジヒドロキシクオーターフェ ニル誘導体、および式(II)

フェニル (以下 DOQ と略配する)は、4-プロム - 4'-メトキシピフェニルを鋼粉の共存下加熱二 量化接脱メテル化を行なうことにより (J.C.S., 1940,pp1379~1382)、又は4-プロム-4'セドロキシピフェニルをパラジウム触媒の存在 下二量体化することにより (本出願人により出願 の発明方法)、得ることができる。

$$2HO-\bigcirc -Br \xrightarrow{Pd} (1)$$

DOQを、ヒドロキシエチル化剤、例えばエチレンカーポネート、エチレンオキシド又は2 - ハロエタノールと適当な触媒又は散精獲剤の共存下で反応させてソ(ヒドロキシエチル)化 - DOQ(以下 DOQ-EO と略記する)を製造する。

また同様に DOQ を、ヒドロキンプロピル化剤、例えばプロピレンカーポネート、プロピレンオキサイド、又は 2 - ハロプロパノールと適当な 放供又は酸捕獲剤の共存下で反応させて、ジ(ヒドロキンプロピル)化 - DOQ (以下 DOQ-PO と略記する)を製造する。

それらの反応式を次に示す

触媒

 $\longrightarrow$  DOQ-EO+(m+n)CO<sub>2</sub>

酸捕獲剤(A)

→ DOQ-PO+(m+n)A·HX

(反応式 3)及び 6) で X は ハロゲン 原子、 A は 敷 推獲 剤を 表 わ ナ }

1) 式の反応については後述する。 2) 式の反応は、通常不活性裕雄中で DOQ と 2 モル以上のエチレンオキシドとを密閉反応器中で触媒(有機又は無機塩素)の共存下に加熱することにより行なわれる。 3) 式の反応は、通常不活性溶媒中で DOQ と 2 モル以上の 2 ーハロエタノールとを密閉反応器中で放射 (有機又は無機塩素)の共存下に加熱するとにより行われる。また、 4) 式の反応については通常不活性溶媒中で DOQ と 2 モル以上の 共存下に加熱することにより行なわれる。 5) 式の反応は、通常、不活性溶媒中で DOQ と 2 モル以

改排獲剂(A)

 $\longrightarrow$  DOQ-EO+(m+n)A·HX

触 媒 ——→ DOQ-PO

上のプロピレンオキシドを触媒(有機又は無機塩基)の共存下に行なわれる。 6) 式の反応は、通常不活性溶媒中で DOQ と 2 モル以上の 2 - ハロプロパノールとを密閉反応器中で酸捕獲剤(有機又は無機塩基)の共存下に加熱することにより行なわれる。

上記6種の反応において、2)式の反応はエチレンオキシドの付加モル数の制御が困難であり3) 式及び6)式の反応は反応速度が遅く、副反応(特

に X-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH、 X-CHCH<sub>2</sub>OH の閉環又は自己重合反応)の発生が大きい。これに対して、1) 式及び4)。5) 式の反応は反応速度が早く、付加モル数の制御も容易で、特にm=n=1 である DOQ-EO すなわち次式(Ia)、及び DOQ-PO すなわち次式(Ib)

で扱わされる化合物の製造に適している。

次にエチレンカーポネートを使用する場合の本 発明の製造方法 (1)式の反応 )の実施 態様例につ いて説明する。

提择機、温度計、還流冷却器及び裝入口を傭えた反応器に DOQ 、エチレンカーポネート及び不活性密媒を装入する。エチレンカーポネートの使用量は目的物の式(I)の化合物のエチレンオキシド基合有数に応じて選択される。

例えば式(I)のm=n=1 である場合は、 DOQ 1 モル当りエチレンカーポネート 2 モル以上( 4 モル程度まで)、m=n=2 の場合は 4 モル以上( 8 モル程度まで)が使用されるが、mおよびnの数は反応温度及び時間、触媒量によっても制御される。

式(1)のm及びnの数は使用目的によって選択さ

4~6時間行なわれるが、液体クロマトグラフにより目的物の生成状況をチェックしながら制御するのが有利である。

反応終了後反応混合物を冷却、沪過、洗浄して目的物を得る。この場合沪過がやや困難であるので、反応混合物を静置して上澄液を傾斜分離し、 沈降物に洗浄液を加えて、攪拌、静置、分液後沪過又はそのまま乾燥する。洗浄液の操作は使用した溶鉄に応じて適宜選択される。

かくして得られた粗製 DOQ-EO は通常再結晶精製を行なう。 粗製 DOQ-EO 1 部に対して適当な溶媒例 えばスルホラン 3 0 ~ 4 0 部を加えて 1 5 0 で前後に加熱、溶解、必要ならば活性炭を添加し、熱炉過し、必要ならば 5 ~ 1 0 でに冷却し、析出物を炉過、洗浄、乾燥して精製品を得る。精製を改をさらに濃縮(熱炉過)、冷却、炉過してを放射のである。 これらは通常再結晶に循環使用することができる。

#### 〔寒始例〕

次に本発明の実施例について説明する。

れるが、通常20程度までで、特にm=n=1の ものが広く有利に使用される。

不活性溶鉄は DOQ 1 部(重量、以下同じ)当り 1~100部、通常3~50部程度を使用する。 溶鉄は DOQ 及び/又は DOQ-EO を必ずしも溶解する 必要はなく、反応は懸濁状態でも十分進行する。 不活性溶媒としてはエチレングリコール低級アル キルエーテル、プロピレングリコール低級アルキ ルエーテル、ペンセン、トルエン、キシレン、 N,N - ジメチルアセトアミド、N,N - ジメチルホ ルムアミド、スルホラン(テトラヒドイチオフェ ン - 1.1 - ジオキシド)、1.3 - ジメチル - 2 -イミメソリシノン等が列挙される。溶媒は必ずし も必要でないが操作上は使用した方が都合が良い。 上記准合物を提择下環流温度又は130°~250 でに加熱し、触媒を添加する。触媒としては、塩 基性化合物、例えば水酸化アルカリ、炭酸アルカ リ等が使用される。使用量は DOQ の 0.1~10 重 量が程度である。

反応は向温度で通常1~15時間、好ましくは

### 突施例 1

提择機、温度計、遠流冷却器及び接入口を備えた反応器に DOQ 6 7.9 8 ( 0.2 モル ) 、エチレンカーポネート 5 2.8 8 ( 0.6 モル ) 及びスルホラン(テトラヒドロチオフェン・1,1 - ジオキシド) 4 6 0 8 を接入し、提拌下 1 3 0°~1 4 0 ℃で無水炭酸カリウム粉末 0.2 8 を、約 3 0 分後さらに0.2 8 (計 0.4 8 ) を添加後、同温度に 3 0 分間保ったのち、昇温し 1 6 0 ℃で約 3 時間反応させた。

反応混合物を冷却後、吸引ろ過し、水洗し、メ タノール 5 0 0 単で洗浄した後、1 0 0 ℃で約 2 時間減圧乾燥して灰白色の結晶 8 3.4 8 (粗収率 9 8 参対 DOQ )を待た。

との租 DOQ-EO を 2 5 0 0 配のスルホランから再結晶して得られた精製品は、白色結晶で DTA で削定した融点が 3 9 0 ℃ ( 偏光融点顕微鏡法で 412 ℃ )、液体クロマトグラフによる純度が 9 9.0 %であった。とのものの元素分析値は次の通りで、一般式(I)の R がエチル基で m 及び n が 1 である前

配式(la)で扱わされる化合物(分子式 C28H24O4 ) であることが認められた。

#### 元素分析值

C(%) H(%)

測定值 79.65 6.25

理論値 78.85 6.15

(C28H26O4 として)

又このものの赤外級吸収スペクトル(臭化カリ ウム錠剤法)を第1図に示す。

#### 実施例 2

奥施例 1 と同様の基置を有する反応器に DOQ 6 7.6 8 (0.2 モル)、プロピレンカー ポネート 6 1.2 8 (0.6 モル)及びスルホラン 4 6 0 8 を 接入し、提拌下 1 3 0 ~ 1 4 0 でで無水炭酸カリウム粉末 0.2 8 を、約 3 0 分後さらに 0.2 8 (計 0.4 8)を添加後、同温度に約 3 0 分間保ったのち、昇温し 1 6 0 でで約 3 時間反応させた。

反応混合物を冷却後吸引ろ過し、水洗し、メタノール500mlで洗浄した後、100℃で約2時間波圧乾燥して灰白色の結晶87.1g(粗収率

般式(I)でRがイソプロピル基、mmnm1である 式(Ib)の化合物)の赤外線吸収スペクトルであ り、機軸は波数(cm<sup>-1</sup>)、縦軸は透過率(多)を 示す。 9 6 ≸対 DOQ )を得た。

との DOQ を 2500 m のスルホランから再結晶して待られた精製品は白色結晶で融点が 3 5 3 で ( DTA ) 、液体クロマトグラフによる純度が 99.0 がであった。 このものの元素分析値は次の通りで、一般式(i)の R がプロピル基で m 及び n が 1 である 前記式 (1b) で表わされる 化合物 ( 分子式 C<sub>50</sub>H<sub>30</sub>O<sub>4</sub>) であることが認められた。

#### 元素分析值

C(\$) H(\$)

測定値 78.8 6.57

理論値 79.27 6.65

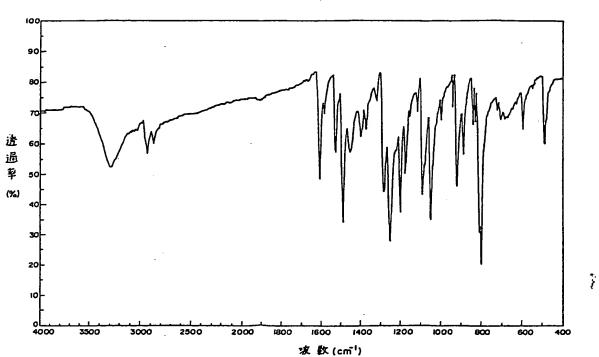
( C<sub>50</sub>H<sub>50</sub>O<sub>4</sub> として)

又とのものの赤外線吸収スペクトル(臭化カリ ウム錠剤法)を第2図に示す。

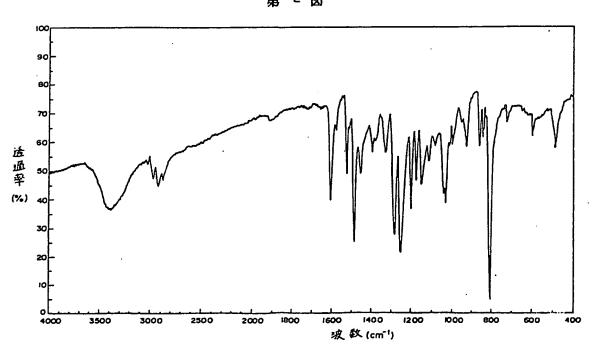
4.図面の簡単な説明

第 1 図は、実施例 1 で得られた精製 DOQ-EO {一般式(I)でR がエチル茜、m = n = 1 である式(Ia) の化合物 ) の赤外級吸収スペクトルであり、 第 2 図は、実施例 2 で得られた精製 DOQ - PO (一





# 第2図



## 第1頁の続き

®Int. Cl. 5	識別配号	庁内整理番号		
C 08 G 18/32	NDS	7602-4 J		
18/48	NDZ	7602-4 J		
63/66	NNG	6904-4 J		
64/02 64/16	NNH NPT NPT	6904-4 J 8933-4 J 8933-4 J		
65/38	NQV	7921 — 4 J		
67/00	NRA	7921 — 4 J		